

An aerial photograph of a modern, multi-story office building with a glass facade. The building is surrounded by a parking lot filled with cars. In the background, there are dense green hills under a clear sky. The text "S&S TECH (주)에스앤에스텍" is visible on the building's facade.

# Investors Relations

Y2025



## Disclaimer.

본 자료에 포함된 "예측정보"는 별도 확인 절차를 거치지 않은 정보들입니다. 이는 과거가 아닌 미래에 관계된 사항으로 회사에 향후 예상되는 경영현황 및 재무 실적을 의미합니다.

자료의 "예측정보"는 향후 경영환경의 변화 등에 따라 변화되며, 불확실성을 내포하고 있는바, 실제 미래 실적과는 차이가 있을 수 있습니다.

본 자료는 투자자/잠재투자자의 편의를 위해 작성된 자료이며, 공시된 내용과의 차이가 있을 경우 공시 내용을 우선으로 참고해 주시기 바랍니다.

본 자료의 활용을 인해 발생하는 손실에 대하여는 그 어떠한 책임도 부담하지 않음을 알려드립니다.



# CONTENTS

## 01

### 회사 소개

- 1-1. 회사 소개
- 1-2. 회사 연혁

## 02

### 사업 소개

- 2-1. Product Application
- 2-2. Key Figures

## 03

### 재무 현황

- 3-1. 재무 현황
- 3-2. 주요 투자 포인트

## 04

### EUV Roadmap

- 4. EUV Roadmap

|       |                              |
|-------|------------------------------|
| 회사명   | 에스앤에스텍, S&S Tech Corporation |
| 대표이사  | 정수홍                          |
| 설립일   | 2001년 2월 22일                 |
| 임직원수  | 305명 (2025년 1월 기준)           |
| 주요 제품 | 반도체, 디스플레이용 블랭크 마스크          |
| 상장    | 코스닥 (101490)                 |
| 본사주소  | 대구광역시 달서구 호산동로 42            |
| 특허보유  | 특허등록 총225건 (국내 104건/해외 121건) |



### EUV Center

- Location : Yongin City
- Establish : '24/3Q
- Land : 8,250 [m<sup>2</sup>]
- C/R : 3,630 [m<sup>2</sup>]
- Product : [EUV product](#)



### 대구 사업장

- Location : Daegu City
- Land : 13,200 [m<sup>2</sup>]
- C/R : 5,450 [m<sup>2</sup>]
- Product : Optical Mask Blank & [EUV product](#)

2001 ~ 2009

## 1. Market Entry

- 회사 설립
- 국내 최초 반도체, 디스플레이용 블랭크 마스크 개발 및 양산
- 2005년 제6회 중소기업 기술혁신대전 대통령상
- 2006 대한민국 10대 신기술 지정
- 2000만불 수출탑

2009 ~ 2016

## 2. Growth Period

- High-End 시장 진입
- 2009 코스닥 상장
- 2014 월드 클래스 300
- 2016 대구 제2공장 준공

2017 ~ 2024

### 3. Expansion Period

- 2017 EUV Pellicle 개발 시작
- 첨단기술기업 지정
- 2020 EUV Blankmask 개발 시작
- 2024 용인 EUV Center 준공

2025 ~

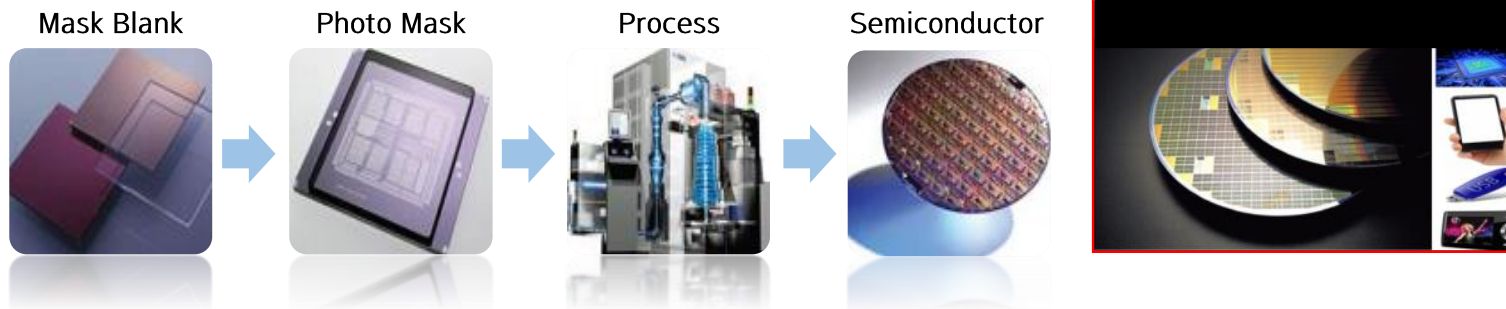
### 4. Upcoming Items

- EUV Pellicle Business
- EUV Mask Blank full development & Business

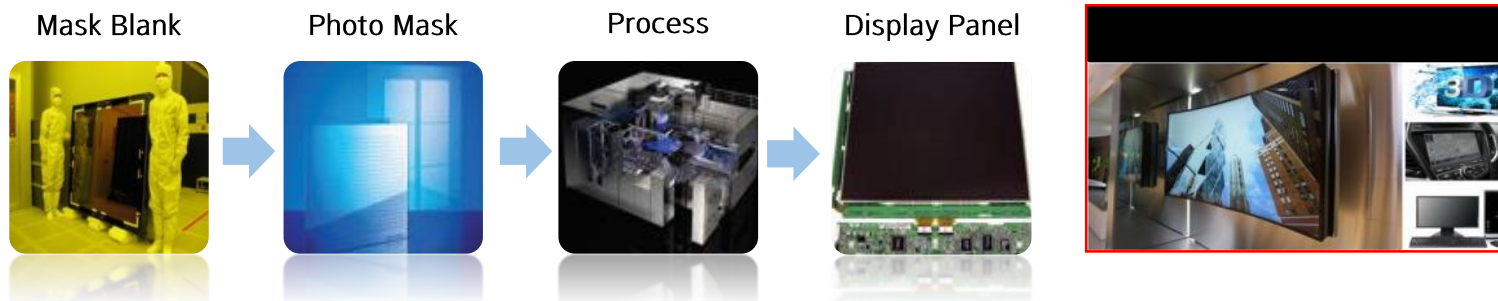
## 국내화 최초 성공한 Blankmask

- 블랭크 마스크는 반도체 (메모리& 비 메모리) 및 디스플레이 (TFT-LCD, OLED, LED) 제조 공정에 필수적인 포토 마스크의 **핵심 원재료** 입니다.

### Semiconductor Mask Blank



### Display Mask Blank



Key Figures

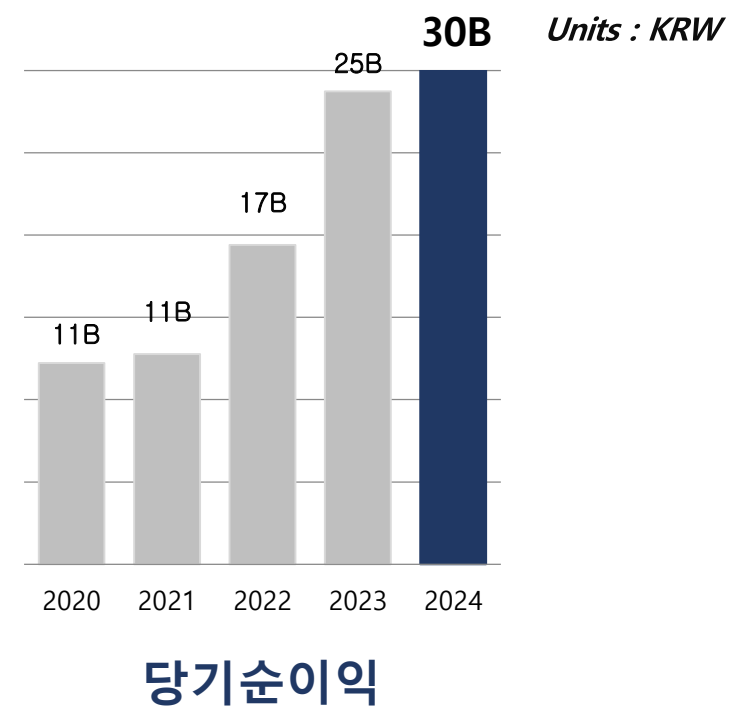
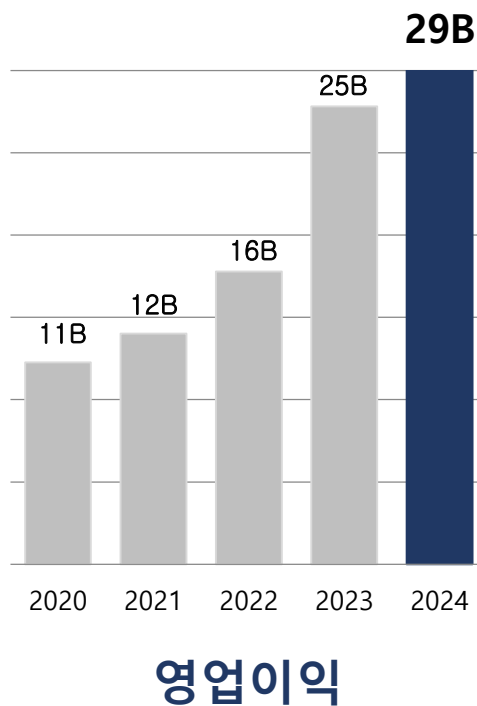
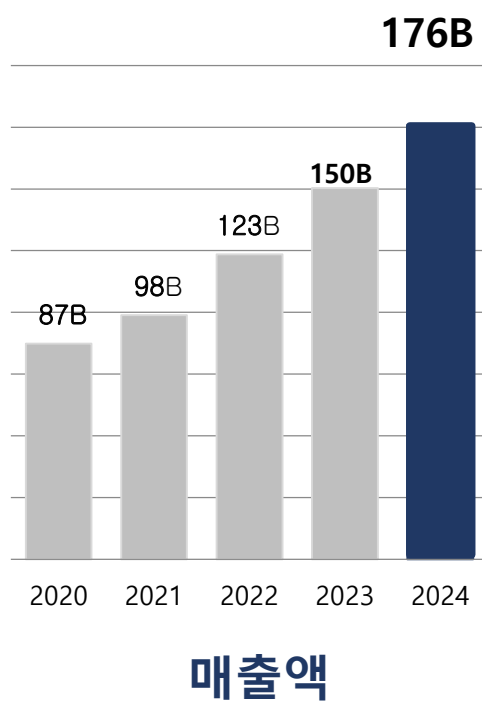


|       |                                 |                                   |                                     |                    |
|-------|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| 재무 현황 | +19% YoY                        | +27% YoY                          | 176B                                | 29B                |
|       | 매출액 5Y CAGR<br>2020~2024 (연결기준) | 영업이익률 5Y CAGR<br>2020~2024 (연결기준) | 매출액<br>Y2024 연결기준                   | 영업이익<br>Y2024 연결기준 |
| 보유 현황 | 225                             | 305                               | Investment,<br>Bio Lab              | Units : KRW        |
|       | 특허 보유 수<br>국내외 포함               | 임직원 수<br>2025년 01월 기준             | 자회사 보유<br>S&S Investment<br>S&S Lab |                    |
| 고객 현황 | About 66%                       | About 30+                         |                                     |                    |
|       | 국내 외 매출 비중                      | 고객사 수<br>국내외 포함                   |                                     |                    |



## 2024년도 재무 현황 (연결 기준)

- 2024년 기준으로 매출 1,760억, 영업이익 295억으로 지난 5개 년간 연간 성장률 약 19% 이상 유지하였습니다.
- 차세대 반도체 시장과 늘어가는 디스플레이 시장의 점유율로 인하여 매출액은 연간 늘어가는 추세입니다.



## Key Investment Points

---

### 01. 지속적인 매출 성장성

- ✓ 지난 5개 년간 19% 이상의 꾸준한 매출 성장률과 27%이상의 영업이익률 성장률 달성

### 02. 미래지향적 사업 구조

- ✓ 차세대 반도체 개발 양산을 위한 시설 및 장비 투자
- ✓ 용인 반도체 클러스터 내 EUV Center 설립 및 최종 양산을 위한 검사 장비 투자

### 03. 반도체, 디스플레이 시장의 성장

- ✓ 반도체, 디스플레이 시장 성장에 따른 M/S 확보 및 고객사 선점

### 04. 고객사 브랜드 이미지 및 네트워킹 노하우

- ✓ 기존 해외 고객사들과 쌓아온 Connection과 네트워킹 노하우를 베이스로 더 넓고 다양한 고객사 target

## EUV R&D Roadmap

- 에스앤에스텍은 2017년부터 EUV 제품 R&D에 투자 지원을 진행하였으며, top-tier R&D 시스템을 통한 사업화 구조가 구축되어 있습니다.



# 감사합니다.

EOD